

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2005-513777(P2005-513777A)

【公表日】平成17年5月12日(2005.5.12)

【年通号数】公開・登録公報2005-018

【出願番号】特願2003-553609(P2003-553609)

【国際特許分類】

H 05 K 1/03 (2006.01)

H 01 L 21/312 (2006.01)

H 01 L 21/316 (2006.01)

H 05 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 05 K 1/03 6 1 0 H

H 01 L 21/312 C

H 01 L 21/316 G

H 05 K 3/46 T

【手続補正書】

【提出日】平成17年10月7日(2005.10.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

誘電性層の製造方法において、多官能性カルボシランのゾル・ゲル・生成物を熱処理することを特徴とする、誘電性層の製造方法。

【請求項2】

請求項1記載の方法により製造可能である、誘電性層。

【請求項3】

層が0.01-100μmの層厚を有している、請求項2記載の誘電性層。

【請求項4】

高集積された超小形電子回路の製造において、チップ・パッケージングの際に、マルチチップ・モジュールを組み立てるため、並びに積層プリント基板及びディスプレイの製造のための絶縁層としての、請求項2記載の誘電性層の使用。